科学研究費助成事業

研究成果報告書



研究成果の概要(和文):グローバルな水不足問題解決や各種励起光源の小型化のため、安価な固体深紫外線光 源の実現が望まれている。本研究では、禁制帯幅波長が深紫外線域にあり、巨大な励起子効果が期待できる六方 晶窒化ボロン(h-BN)微結晶・エピタキシャル膜の輻射・非輻射再結合ダイナミクスを明らかにするため、日本 に唯一の時間空間同時分解蛍光計測装置を高機能化し、発光寿命や空間分布計測を行った。その結果、h-BNは間 接遷移型半導体であるがよく光ること、その原因が巨大な励起子効果(強いフレーリヒ相互作用)により、フォ ノン散乱を介して運動量保存則を満たせるからであることを明らかにした。また、欠陥による影響も明らかにし た。

研究成果の概要(英文): To cope with the water shortage problem and to downsize a variety of photo-excitation sources, there has been a strong demand to realize low-cost solid-state deep-ultraviolet (DUV) light emitters. Since hexagonal boron nitride (h-BN) exhibits DUV lights at approximately 215-240 nm and is predicted to show strong excitonic effects in its optical spectra, h-BN is one of the promising semiconductors of DUV and UV light emitters. In this research project, radiative and nonradiative recombination dynamics of excitons of h-BN microcrystals (MCs) and epilayers in the DUV wavelength region were investigated by using our unique spatio-time-resolved cathodoluminescence (STRCL) equipment. The h-BN samples exhibited distinct DUV luminescence peaks although the spectral features indicated an indirect bandgap nature of h-BN. The result indicates a strong interaction between the indirect excitons and phonons due to the excitonic effect.

研究分野:工学

キーワード:半導体物性 励起子 光電子銃 窒化ボロン

1.研究開始当初の背景

グローバルな課題である、安全な飲料水不 足の解決策として、深紫外線(DUV)光源を用 いた高速大量殺菌消毒が注目されている。そ の実現には、高効率で深紫外線を発し、かつ 劣化しない物質が必須であり、高AIN モル分 率 AIGaN 量子井戸発光ダイオード(LED)の開 発が進められている。しかしながら、LED 実 現には n 型層と p 型層の形成が必須であり、 アクセプタの活性化エネルギーが大きいワ イドバンドギャップ半導体では p 型層の形成 が極めて困難であることから、コストパフォ ーマンスで勝れば電子線励起固体光源とい う選択肢もある。

族窒化物半導体 InGaN 混晶を用いた青 色 LED が 2014 年ノーベル物理学賞の受賞対 象となった事は記憶に新しいが、 族窒化物 半導体には、AIN や BN 等、DUV 波長領域に禁 制帯幅を持つ材料があり、Beyond Nobel Prize 級の発光受光デバイスを実現できる可 能性がある。報告者らは、安価に大量生産が できそうな六方晶層状窒化ボロン(h-BN)微 結晶の評価を行う過程で、測定温度の変化に 対してバンド端発光強度があまり変化せず、 励起子の特長が表れているのではないかと 考えていた。

h-BN 発光素子の実現には、励起子の振動 子強度を反映する輻射再結合寿命や、その空 間分布に対して非輻射性の欠陥が与える影 響等を明らかにしなければならないが、研究 例は殆ど無かった。この原因には、高品質結 晶と、ワイドバンドギャップ半導体の励起手 段が極めて限られていたことが挙げられる。 輻射寿命や非輻射寿命の空間分布を定量化 する手法として報告者らは、走査型電子顕微 鏡(SEM)にフェムト秒光電子銃を搭載した、 時間・空間同時分解カソードルミネッセンス (STRCL)装置を構築し、GaN や AIN の評価を行 ってきた。報告者らの STRCL 装置は、波長 200nm 台での局所・時間分解発光計測を世界 で初めて実現したものである。

2.研究の目的

本研究の目的は、STRCL 装置に用いる光電 子銃の強度を高くして高輝度パルス電子線 を発生し、静大原和彦教授グループから提供 される h-BN 微結晶・エピタキシャル薄膜の発 光特性の計測を通じて励起子の輻射・非輻射 再結合寿命の温度依存性および空間不均一 性を定量化し、結晶成長の最適化を支援する。 もって高効率固体深紫外線光源の基盤とす る。

3.研究の方法

東北大はまず、h-BN 微結晶及びエピタキ シャル薄膜の、微細領域におけるピコ秒台の 励起子発光過程の観測のため、表面を原子層 レベルで平坦化させた Au を SEM 鏡筒の上部 に置換配置した光電子銃内に設置してバイ アスし、紫外線に対し透明なガラスを通して



図2前面入射型光電子銃を搭載した STRCL 装置

CCD

SEM

フェムト秒 AI₂0₃:Ti レーザの第3高調波を前 面側から照射し、高輝度フェムト秒パルス電 子線を発生させた。それを多段電界加速機能 と集束機能にて SEM 鏡筒の電子線源位置に導 入し、最後に SEM のレンズを用いて試料上の ナノメートル台の微小領域に集束する事に より STRCL 計測系を構築した。そして、静大 で作製された、h-BN 微結晶やエピタキシャル 薄膜の計測を行い、BN の発光機構すなわち励 起子発光寿命や空間的不均一性、局在機構を 明らかにした。研究体制を図1に示す。また、 STRCL 装置のポンチ絵を図2に示す。

4.研究成果

(1)高性能化光電子銃と STRCL 装置

3.に記した手法にて、BN 微結晶やエピ タキシャル薄膜のようなワイドバンドギャ ップ半導体の STRCL 計測における空間分解能 を改善できた。測定条件にもよるが、CL 計測 を考え、10kV 以下の加速電圧にて STRCL 計測 を行うこととした。

(2)h-BN 粉末の熱処理による微結晶化及び化 学気相堆積法による h-BN エピタキシャル薄 膜の形成

市販の低純度 h-BN 粉末(>99%)を、900 で 2 時間、酸素雰囲気中で熱処理を行った h-BN 微結晶の SEM 像と x 線回折(XRD)パターンを 図 3 に示す。微結晶は直径 5~10 μm、厚さ 0.5~2 μm のプレート状物質であり、XRD パ ターンには h-BN の回折のみ観測された。こ れらの微結晶は、フーリエ変換型赤外線 (FTIR)吸収スペクトル測定、波長分散型 x 線 組成分(EPMA),x 線光電子分光(XPS)により不 純物や結合状態評価を行った。



図 3 h-BN 微結晶の SEM 写真と x 線回折パターン

一方、サファイア c 面上への h-BN 薄膜の 化学気相堆積(CVD)法によるエピタキシャル 成長は、BCI₃-NH₃-N₂系ガスを用い、温度1300 ~1400℃、圧力 5 kPa で 2 時間堆積させたも のである。薄膜は c 面配向しているが、サブ マイクロメートル程度のグレイン状結晶で あった。

(3)h-BN 微結晶の発光ダイナミクス

h-BN 微結晶の広域 CL スペクトルとそのバ ンド端(NBE)詳細を図 4(a)、(b)に示す。12K の CL スペクトルには、約 5.93 eV の裾状の 肩、5.86 及び5.76 eV の各々にダブレットピ ーク、5.5eV-band と記す発光帯、そして 4.0eV -band と記す発光帯が観測された。詳細には、 高エネルギーダブレットピークは 5.89 及び 5.86 eV の発光、低エネルギーダブレットピ ークは 5.79 及び 5.76 eV の発光からなる。 5.93 eV の発光と計4つのダブレット発光ピ ークエネルギは、それぞれ、間接遷移自由励 起子(iX)の ZA(T), TA(T), LA(T), TO(T), LO(T)フォノンレプリカと同定される。ここ で、括弧内のTはブリルアンゾーンのT点を 意味しており、各々のフォノンエネルギーは、 光るための運動量保存則を満たす MK ベクト ルを K 上に平行移動した中央である T 点で の値となっている。これらの発光は、図4(b) に示すように X_{ZA(T)}, X_{TA(T)}, X_{LA(T)}, X_{TO(T)}, X_{LO(T)} と略す。このように、h-BN の禁制帯は間接遷 移型であるにも関わらず、室温でも発光する。 この結果は、間接遷移型半導体としては興味 深い現象である。図4(c)に、各々の発光帯の 強度のアレニウスブロットを示すが、NBE 発 光は温度上昇させてもあまり熱消光しない。

これら h-BN 微結晶の NBE 発光の絶対発光 量子効率は測定しておらず、微結晶かつ間接 遷移のため光取り出し効率は高いと考えら れるものの、間接遷移型禁制帯の h-BN が、 かように発光しやすく消光しにくい事には 特別な物理があると考えられる。ひとつの説 明は、iX とフォノンの強い相互作用である。 実際、励起子の束縛エネルギーが大きく(130 meV)有効ボーア半径(a)も0.3 nm と極めて小 さくフレーリヒ相互作用が強いため、特に L0(T)及び T0(T)と、そして LA(T)及び TA(T) フォノンとも相互作用は強いと計算される。 もう一つの解釈は、a。が小さく有効質量も大





きい h-BN の励起子は、あまり長距離移動で ないため非輻射再結合中心(NRC)に捕まりに くいという事である。簡単な試算では、極低 温であれば NRC 濃度(M_{RC})が 10²⁰ cm⁻³近くま で発光強度が変わらないと見積もられ、2 次 元結晶の特徴が表れている可能性がある。

一方、図 4(c)に示すように、今回用いた 試料は低純度の微結晶であるにも関わらず NBE 発光が熱消光しにくかった原因の一つと して、高温酸化によって h-BN 表面に、B₂O₂ 系の封止ガラス剤のような物質が形成され ているのではないかと考え、FTIR 測定や XPS 測定を行った。その結果、B₂O₃ にほぼ近い結 合状態が h-BN 表面に観測された。この物質 が表面再結合を抑制する効果を持っている と考えられる。

7K における、 $X_{ZA(T)}$ 、 $X_{LA(T)/TA(T)}$ 、 $X_{LO(T)/TO(T)}$ の広域 TRPL 信号を図 5 の下 3 つのトレース に示す。信号は 2 成分指数関数を用いてフィ ットすることが可能であり、減衰寿命の第 1 成分 τ_1 はいずれも 34 ps 程度であった。この 値は、iX リザーバーの非輻射再結合寿命(τ_{RR})



図 5 h-BN 微結晶のスペクトル分離 TRPL 信号

を表していると考えられる。34ps という値は、 高品質単結晶を用いて測定された報告値で ある 60 ps や 130 ps よりは短いが、異なる 研究者の報告した 600 ~ 750 ps という値より は単結晶のそれに非常に近い。従って、我々 の計測は正しく行えており、絶対値について も結晶品質を考慮すれば妥当な値である。

間接遷移励起子発光群に続き、5.5 eV 発 光帯について起源の検討を行った。結果は図 4(b)に示したが、大別して3つの起源がある。 それらは、iXのLO(T),TO(T)フォノンレプリ カダブレット[X_{L0(T)/T0(T)}]が、さらに K 点にお いて TO(K)フォノン散乱を1回ないしは多数 回受けたフォノンレプリカ群[X_{LO(T)/TO(T)+nTO(K)}] 及び欠陥に起因するとされる発光 D,及び D。 である。これらの発光は、他者の報告例にも アサイメントは違えど観測される事があり、 h-BN に特有な特異構造起因の発光といえる。 iXのフォノンレプリカ群と異なり5.5eV帯の み熱消光を示す事から、5.5eV 帯は、状態密 度を持つ欠陥構造等に局在した励起子の発 光であろうと考えられる。D₂の熱消光は、他 の X_{LO(T)/TO(T)+/TO(K)}や D₆ に比べて低温から始ま り、熱消光の度合いは D₂>2TO(K)>D₆>1TO(K) であった。従って、D₀欠陥より D₂欠陥の局在 ポテンシャルが浅いものと考えられる。

図 4(c)に示すように、4.0eV 帯は約 100 K 以上の温度で逆熱消光を示し、5.5eV 帯と同 期して逆の温度依存性を示したことになる。 従って、5.5eV 帯の起源である特異構造は、 NRC や4.0 eV 帯の起源に取り囲まれていると 考えられる。4.0 eV 帯の起源については、酸 素や炭素不純物、窒素空孔(V_N)欠陥等の報告 があるが、我々は N サイトの炭素(C_N)また は B 空孔と酸素の複合体(V_BO_N)が起源では ないかと考えている。

5.63 eV の $X_{LO(T)/TO(T)+1TO(K)}$ 発光、および 5.56 eV の D_2 発光の 7K における TRPL 信号を図 5 に示す(上から 2本のトレース)。それらの 減衰曲線は 2 成分指数関数によりフィットで き、 τ_1 および τ_2 は各々約 60~100 ps と 1.2 ns 程度であった。後者の寿命については既報に も見られた ns 台の値であったが、短い寿命 τ_1 についてはこれが初めての観測報告である。 τ_1 の値は iX のフォノンレプリカ群のそれに 近く、励起子リザーバーの τ_{NR} を反映している と考えられる。長い寿命 τ_2 も観測されている ことから、該当する特異構造は、低温では局 在励起子をNRCに捕まりにくくさせる障壁として働いているようにみえる。温度上昇に従い励起子の局在は解け、NRCに辿り着くようになってしまうと考えられる。発光寿命の温度依存性は図4(c)のCL強度の温度依存性とも対応しており、その温度範囲では5.5eV帯のダイナミクスを_{TR}が支配しているとみてよい。

図 6(a)に SEM 像を示す h-BN 微結晶の STRCL 計測結果を図 6(b)-6(1)に示す。同図 (b)と(c)に、20K におけるパンクロ CL 強度像 と広域の時間積分 CL スペクトルを示す。(b) 図の明部に相当する 4, 7, 3, 2 番のゾーン は基本的に Mac の低い領域であり、iX のフォ ノンレプリカないしは 5.5eV 帯が明るい。 各々、X_{L0(T)/T0(T)}とX_{LA(T)/TA(T)}の単色 CL 像[同図 (f)および(g)]ないしは X_{LO(T)/TO(T)+2TO(K)}および D2の単色 CL 像[同図(d)および(e)]から明ら かである。この結果は、iX レプリカと 5.5eV 帯の単色 CL 像が逆相関するという既知の知 見と矛盾しない。従って、励起された iX は 瞬時に5.5eV帯の起源に捕獲されるか、ある いは局所的に禁制帯幅が低い特異構造が 5.5eV 帯の起源であると考えられる。

図 4(c)に示した熱消光比と同様に、iX と 5.5eV 帯の発光寿命は、図 6(h)-5(1)に示す ように異なる温度依存性を示した。すなわち、 $X_{LA(T)/TA(T)} \ge X_{LO(T)/TO(T)}$ の発光寿命は温度変化が 少なく約 30~40 ps であった。この結果は、 寿命も消光比もほぼ温度依存性が無い、すな わち輻射再結合寿命 $\alpha_R = \tau_{RR}$ もほぼ温度依存性 が無い事を示している。iX の真性 α_R は、間接





遷移型なのでもっと長いと考えられるため、 MK と等価なベクトルを持つフォノン散乱が、 観測にかかる見かけ上の α_{R} を短くしていると 考えている。図 $6(\ell)$ に示すように、 $X_{LO(T)/TO(T)+2TO(K)}$ とD2の遅い寿命 α_{O} のみが温度上 昇に従って減少しており、 α_{I} には温度依存性 が殆ど無い。 α_{2} の減少が熱消光と同期してい る事から、 α_{2} が特異構造に局在した励起子の α_{RR} を決めていると考えられる(励起子のいく らかは、4.0 eV 帯に緩和している)。

(4)h-BN エピタキシャル薄膜の発光ダイナミ クス

CVD 製膜した c 面配向 h-BN エピタキシャ ル薄膜の発光スペクトルは基本的に微結晶 と同様であったが、欠陥による深い準位によ る発光ピークよりも、NBE 発光、特に iX のフ ォノンレプリカの発光が室温においても一 番強く観測された。この結果は、CVD 薄膜の 純度が高く、結晶品質においても、高温成長 の効果が表れていると考えられる。

以上のように、STRCLを用いて DUV 発光素 子材料である h-BN 微結晶、エピタキシャル 薄膜の発光ダイナミクスを明らかにできた といえる。

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(1件)

<u>S. F. Chichibu</u>, Y. Ishikawa, H. Kominami, and <u>K. Hara</u>, Nearly temperature-independent ultraviolet light emission intensity of indirect excitons in hexagonal BN microcrystals", 查読有, Journal of Applied Physics 123 (6), pp. 065104 1-8 (2018). DOI:10.1063/1.5021788.

〔学会発表〕(計11件)

(招待講演5、一般講演6)

<u>S. F. Chichibu</u>, N. Umehara, K. Shima, <u>K. Kojima</u>, and <u>K. Hara</u>, Luminescence spectra of hexagonal BN thin films grown by chemical vapor deposition on a *c*-plane sapphire substrate, 招待講演, The 3rd International Conference on Physics of 2D Crystals (ICP2C3), No.We1130 (2018).

<u>秩父重英</u>,梅原直己,<u>小島一信,原和彦</u>,サ ファイア基板に気相成長させた六方晶 BN 薄 膜の発光スペクトル,2018 年春季応用物理学 会,17p-E202-17 (2018).

<u>原和彦</u>,梅原直己,小島一信,秩父重英,六 方晶 BN の薄膜成長とその深紫外発光評価, 招待講演,多元系化合物・太陽電池研究会 企画シンポジウム,2018 年春季応用物理学会, 17p-C102-1 (2018).

<u>S. F. Chichibu</u>, Y. Ishikawa, H. Kominami, and <u>K. Hara</u>, Spatio-timeresolved cathodoluminescence of h-BN microcrystals, 招待講演, The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Photonics West 2018, Gallium Nitride Materials and Devices XIII (OE107), No.10532-18 (2018).

<u>原和彦</u>,梅原直己,<u>秩父重英,小島一信</u>,光 野徹也,小南裕子,サファイア基板上に成長 した六方晶窒化ホウ素薄膜の深紫外カソー ドルミネッセンス,招待講演,日本結晶成 長学会第46回結晶成長国内会議(JCCG-46), 27p-B05 (2017).

N. Umehara, T. Kouno, H. Kominami, <u>K.</u> <u>Kojima, S. F. Chichibu</u>, and <u>K. Hara</u>, Cathodoluminescence characterization of the hexagonal boron nitride thin films grown on c-plane sapphire substrates, International Workshop on UV Materials and Devices (IWUMD) 2017, No.Th-P31 (2017).

<u>S. F. Chichibu</u>, Y. Ishikawa, H. Kominami, and <u>K. Hara</u>, Spatio-timeresolved cathodoluminescence studies of hexagonal BN microcrystals, International Workshop on UV Materials and Devices (IWUMD) 2017, No.Th-P23 (2017).

<u>秩父重英</u>,石川陽一,小南裕子,<u>原和彦</u>,六 方晶 BN 微結晶の発光ダイナミクス評価(4), 2017 年秋季応用物理学会, 8a-A301-4 (2017).

<u>秩父重英</u>,石川陽一,小南裕子,<u>原和彦</u>,六 方晶 BN 微結晶の発光ダイナミクス評価(3), 2017 年秋季応用物理学会, 8a-A301-3 (2017).

<u>S. F. Chichibu</u>, Y. Ishikawa, Y. Kominami, and <u>K. Hara</u>, Spatio-Time-Resolved Cathodoluminescence studies of h-BN microcrystals, The 12th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-12), No.A.1.24 (2017).

<u>S. F. Chichibu</u>, Y. Ishikawa, Y. Kominami, and <u>K. Hara</u>, Spatio-timeresolved cathodoluminescence studies on hexagonal BN microcrystals, 招待講演, The 2nd International Conference on Physics of 2D Crystals (ICP2C2), No.2-16h45 (2017).

[その他]

ホームページ http://www.tagen.tohoku.ac.jp/labo/chic hibu/paperlist.html

6 . 研究組織

(1)研究代表者
秩父 重英(CHICHIBU, Shigefusa)
東北大学・多元物質科学研究所・教授
研究者番号:80266907

(2)研究分担者

小島 一信 (KOJIMA, Kazunobu)

東北大学・多元物質科学研究所・准教授 研究者番号:30534250

原 和彦(HARA, Kazuhiko)
静岡大学・電子工学研究所・教授
研究者番号:80202266